

知产科普

国知局：2025 年严把专利审查授权关，加强创造性标准评价

近日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，邀请国家知识产权局局长申长雨、国家知识产权局副局长胡文辉介绍 2024 年中国知识产权强国建设有关情况。

国家知识产权局局长申长雨在新闻发布会中提到：严把专利审查授权关，加强创造性标准评价，继续推动发明专利平均审查周期再压减至 15 个月。探索推动人工智能、大数据、量子技术等重点产业领域按需审查。丰富商标审查政策供给，扩大商标注册申请快速审查适用范围。近年来，国家知识产权局持续提高专利审查的质量和效率，目前发明专利的平均审查周期已经压减至 15.5 个月，达到相同审查制度下国际的最快水平；发明专利审查结案准确率达到 95.2%。

国知局提醒！专利申请文件的核心应尽量避免引入与技术方案无关的内容

近日，国家知识产权局发布了关于进一步规范专利申请文件撰写要求的业务提醒。其中提到，为进一步提高专利申请文件的规范性，节约申请获权程序，依据《专利审查指南》相关规定，对专利申请文件的撰写作出以下提醒。

1. 专利申请文件的核心是其记载的技术方案，应尽量避免引入与技术方案无关的内容，尤其是说明书背景技术和附图部分。

2. 说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术及相应文件，说明背景技术中存在的问题和缺点时应围绕技术内容开展，尽量避免引入政治、经济、文化等与技术不直接相关的信息。

3. 对于说明书附图，建议仅在与保护范围紧密相关时引入地图。确需引入时，申请人应使用标准地图，例如通过自然资源部网站“标准地图服务系统”(<http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/>)获取，以确保地图的准确性、合法性和权威性。以标准地图为基础制作附图时，应遵守相关法律法规和部门规章。

联系我们

地址：北京市东城区东方广场东方经贸城西一办公楼 5 层

电话：(86 10) 8529 5526 **邮箱：**teehowe@teehowe.com **网址：**www.teehowe.com

Disclaimer: The text of this newsletter is for information purpose only. Tee & Howe disclaims any legal responsibility for any actions you may take based on the text in this newsletter.